® 日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

昭61-11049 四公開特許公報(A)

@Int Cl.4

庁内整理番号 識別記号

❷公開 昭和61年(1986)1月18日

A 61 L 2/14

6779-4C

審査請求 未請求 発明の数 2 (全 4頁)

マイクロ波放電プラズマ殺菌装置 る発明の名称

> 顧 昭59-130900 创特

顧 昭59(1984)6月27日

神奈川県高座郡寒川町宮山4494 前羽 @発 明 者

茅ヶ崎市萩園2500番地 日本真空技術株式会社 の出 願 人

弁理士 八木田 茂 外2名 の代 理 人

1. 発明の名称

マイクロ放放電プラズマ数菌装置 1.特許請求の範囲

排気系に連結される排気ポートとガス導入 ポートとを備えた真空容器内に被殺菌物の処理棚 を配置し、また真空客器にマイクロ放導入装置を 取付け、 真空容器内へマイクロ故を導入して内御 にプラズマを発生させるように構成したことを特 数とするマイクロ放放電プラズマ殺菌装置。

ュ 排気系化連結される排気ポートとガス導入 ポートとを備えた真空容器内に被殺菌物の処理棚 を配置し、また英空容器にマイクロ波導入装置を 取付け、 真空容器内へマイクロ故を導入して内部 にプラズマを発生させ、さらに真空容器内にプラ プマ状態を制御する磁場を発生させる磁気装置を 設けたことを特徴とするマイクロ波放電プラズマ 经营格股.

1発明の詳細を説明

産業上の利用分野

本発明は、医療器具等の寂骸に用いられるマイ クロ彼放電プラズマ殺菌装置に関するものである。

従来の技術

従来、医療器具等の殺菌には、高圧蒸気や高温 空気等による加熱寂寞、酸化エテレンガス等によ るガス寂寞、紫外線寂寞や放射線寂寞等が広く用 いられている。

加熱殺菌では被殺菌物が高圧蒸気や高電空気に さらされ、通常100℃以上の高温となるため。 殺菌処理可能な物質は耐熱性である必要があり、 極めて限定されることになる。 従つてどのような 加熱手段を用いてもこの欠点は避けることができ

ガス般菌は、殺菌剤をガス状にして容器内に充 潰させ、ガス要変、温度、温度、圧力等を調節し、 細菌に作用させるようにしたものであつて、低温 で殺菌することができる。 例えばこのガス殺菌に は酸化エチレンが用いられるが、上記の条件調節 が容易でなく、条件の変動によつて作用効果が著 しく左右されることにたる。 またガス殺菌は殺菌

に長時間かかり、しかも被殺菌物の形状が複雑な場合にはガスが十分に浸透せず十分な疫苗が行たわれないなれがあり、また疫苗様においても配化エチレン等の毒性ガスが被殺菌物に吸着し、長時間残留するので殺菌様被風効をすぐに使用できないという欠点がある。

また、常外線数菌は極めて短時間で殺菌効果を発揮するが、常外線ランプの汚れ等で紫外腺強度が低下することにより殺菌効果も落ち、また細菌の密度が104/ed以上では細菌自体の陰影効果により防になる部分は殺菌できない。

さらに放射線 段間はその設備自体が大がかりとなり、一般に通常の使用には不向きである。

上述のような殺菌法の欠点を解消する方法として放電またはプラズマを用いた殺菌方法が知られている。放電殺菌芸費の従来例は例えば特公昭 53-357/3号公敷、特別昭57-19546/号公 戦かよび特別昭57-200/56号公報に記載されている。しかしとれらの公知の放電殺菌装置ではいずれる実空容器内に放電電振が配置されてかり、

との放電電機に高低圧を印加して放低させるため 電極が放電化よつて生成されたイオンでスパッタ され、スパッタされたものが複数裏物に付着し段 関とは別の意味で汚染されることになる。

発明が解決しようとする問題点

そこで本発明は、従来の加熱段割法における高温に伴なり社会の制限問題、ガス段割法に伴なり有害ガスの後旬の問題、 保外級股間法に伴なり殺菌ならの生じる問題かよび放電の改造に行なりを信仰のような、 短時間で待みているを全て無決してできるマイクロ 放放電ブラメマ 段 前蒙世を提供するととにある。

問題点を解決するための手段

上記目的を達成するために、本発明によるマイクロ放放電プラズマ設立を置は、 排気 果に 送詰される排気ポートとガス 導入ポートとを 偏えた 真空 容器内に被殺 裏物の処理 棚を配置し、また 真空容器にマイクロ放送 人 装置を取付け、 真空容器内へマイクロ放を導入して内部にプラズマを発生させ

るようにしたことを特徴としている。

また本発明の別の特徴によれば、上述の装置に かいてさらに真空容器内にプラスマ状態を制御す る磁場を発生させる磁気装置が設けられ、この磁 気装置は永久磁石または磁気コイルから成ること ができる。

作 用

またコイルヤ永久磁石を設けた真空容器内に磁 場を発生させるようにした場合には磁場作用によ つて電子の空間滞在時間がのび、ガス分子と衝突 する回数が増し、プラズマ密度が増加し、段階効 本を上げることができる。 .

夹 施 例

以下添附図面を参照して本発明の実施例について説明する。

第1 図には本発明にはなりでは、 「関係にはののは、 1 では、 2 では、 2 では、 2 では、 2 では、 3 では、 4 では、 5 では、

第2回には第1回に示す姿質の変形実施例を示

し、この場合には真空容器!の構造およびマイクロ技導入装置は全く同じであり、第 / 図と同じ番号で示す。との実施例では真理容器 / 内に磁気を発生させるため永久磁石 / が設けられている。

第4 図にはマイクロ放エネルギを真空容器内へ 場入する方法の別の例を示す。第4 図において真 空容器 / 6 の差に関口部 / 7 が設けられ、この題 口部 / 7 にはコネクタ / 8 が取付られ、コネクタ / 8 から真空容器 / 6 内にはアンテナ / 9 がのび ており、そしてコネクタ / 8 は同軸ケーブル 2 0 を介してマイクロ波亀派(図示されてをい)に接 彼される。

とのように構成された各図示実施例の装置を食 用して殺菌動作を行なり場合には、まず、真空容 爵(/ , タ)内に配置された処理棚(タ , / タ)に処 理すべき被殺貨物を載き、 所定の圧力すて其型ポ ンプを用いて拚気する。 しかる袋、ガス導入ポー ト(1、10)を介して上述のようなガスを真空容 ひ(/,タ)内に導入し、第/図の実施例ではノ。ヨ × 101~1.3×10² Pa 程度、また第2 , 3 図の実 **拠例では / J × / 0 ⁻²~ / J × / 0 ² Pa 程度の圧力に する。この状態においてマイタロ波導簽督 (7./4)** または阿軸ケーブルよりを介して真空容器 (1,9) 内に所定のマイクロ放エネルギを投入する。これ により真空容器(1,9)内にはプラズマが発生さ れ、処理線(メ゙゚ノタ)に度かれた被殺関物の股関 処理が行なわれる。とうして予定の時間後マイタ ロ彼の投入が止められ、そして大気圧まで戻して 被殺菌物を取り出す。このようにして一速の殺菌 処理動作が行なわれる。

なお、 無 4 、 3 図に示すように永久磁石 6 や磁 気コイル 1 3 を用いて真空容器 (1 、9) 内に磁場 を発生させ、 内部に発生したプラズマの 状態を勧 御することによつてより高い 殺菌効率を得ること ができる。

一例として第2日に示すよりな構造の姿配を用いての2プラズマを0.04×102Pmの正力の0を正力の0を正力の0を正力の0を正力の0を正力の0を正式が入って発生としてもである。 「一般では、10年の

効 果

以上説明してきたように本発明においては電低 を用いすにマイクロ放エネルギの投入によつてプ ラズマを発生させ、それにより段散処理を行なり ように構成しているので従来の加熱殺菌法、ガス 殺菌法、紫外線殺菌法をよび放電殺菌法等におけ る欠点を解消して低温、短時間で行楽のないきれ いな殺菌を効率よく行なうことができる。

4.図面の簡単な説明

第/図は本発明の一実施例を示す概略断面図、 第2図は変形実施例を示す概略断面図、 第 3 図は 本発明の別の実施例を示す概略断面図、 第 4 図は マイクロ技導入手段の一例を示す図である。

図中、 / , タ: 其空容器、 2 , / の: ガス導入ポート、 3 , / ギ:排気ポート、 5 , / 3 : 処理棚、 7 , / ギ , / ぎ , / 8 , / 9 , 2 の: マイクロ彼導入装置、 8 , / 5 : 磁気装置。

.特問昭61- 11849 (4)



